(11)Publication number:

11-185020

(43)Date of publication of application: 09.07.1999

(51)Int.CI.

G06T 1/00

A61B 5/117

(21)Application number: 09-356436

(71)Applicant: **GLORY LTD**

GLORY KIKI CO LTD

(22)Date of filing:

25.12.1997

(72)Inventor:

YAMAGUCHI YOSHIKI AUME KATSUAKI

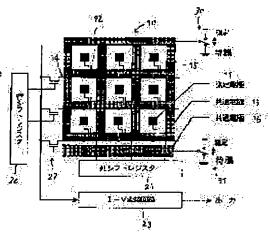
YOSHIKAWA DAISUKE HASEGAWA TADAAKI

(54) INDIVIDUAL AUTHENTICATION SENSOR

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an individual authentication sensor capable of preventing erroneous identification even for a forged replica without the need of perspiration at the time of authentication and without the need of the changeover switch of an input part.

SOLUTION: Plural measurement electrodes 11 are provided on a semiconductor substrate, a first common electrode 13 is provided around the measurement electrodes 11, while a switching element 12 for selectively connecting the respective measurement electrodes 11 and a detection circuit is selected by the scanning of a row shift register 20 and a column sift register 21. A means for switching the common electrode 13 to a power source and the ground at the time of the contact presence/absence detection measurement of a material to be authenticated to the measurement electrode 11 and at a standby time for not performing the measurement is disposed.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-185020

(43)公開日 平成11年(1999)7月9日

(51) Int.Cl.6

識別記号

F I

G06F 15/64

G

G06T 1/00 A61B 5/117

A 6 1 B 5/10

322

審査請求 未請求 請求項の数7 OL (全 11 頁)

(21)出願番号

(22)出願日

特額平9-356436

平成9年(1997)12月25日

(71)出願人 000001432

グローリー工業株式会社

兵庫県姫路市下手野1丁目3番1号

(71)出願人 000105143

グローリー機器株式会社

兵庫県姫路市御国野町国分寺67番地

(72)発明者 山口 良樹

兵庫県姫路市下手野一丁目3番1号 グロ

ーリー工業株式会社内

(72)発明者 安梅 功哲

兵庫県姫路市下手野一丁目3番1号 グロ

ーリー工業株式会社内

(74)代理人 弁理士 安形 雄三

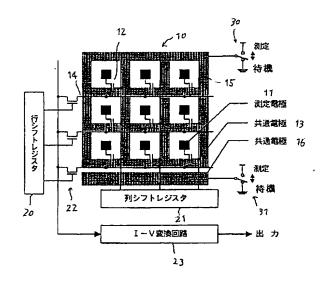
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 個体認証センサ

(57)【要約】

【課題】認証時に発汗の必要もなく、入力部の切り替え スイッチも不要で、偽造されたレプリカに対しても誤識 別を防止できるようにした個体認証センサを提供する。

【解決手段】半導体基板上に複数の測定電極を有し、半 導体基板上に複数の測定電極を有し、『前記測定電極の 周辺に第一の共通電極が設けられており、前記各測定電 極と検出回路とを選択的に接続するスイッチング素子を 行シフトレジスタ及び列シフトレジスタの走査で選択で きるようになっており、前記測定電極への被認証物の接 触有無検出測定時』及び測定を行わない待機時に前記共 通電極を電源及び接地に切り換えるスイッチ手段が配設 されている。



20

2

【特許請求の範囲】

【請求項1】半導体基板上に複数の測定電極を有し、 『前記測定電極の周辺に第一の共通電極が設けられており、前記各測定電極と検出回路とを選択的に接続するスイッチング素子を行シフトレジスタ及び列シフトレジスタの走査で選択できるようになっており、前記測定電極への被認証物の接触有無検出測定時』及び測定を行わない待機時に前記共通電極を電源及び接地に切り換えるスイッチ手段が配設されていることを特徴とする個体認証センサ。

【請求項2】「半導体基板上に複数の測定電極を有し、前記測定電極の周辺に第一の共通電極が設けられており、前記測定電極及び第一の共通電極に隣接または離れた半導体基板上或いはその他の位置に設けられた第二の共通電極を有し、前記各測定電極に接続されたスイッチング素子を行シフトレジスタ及び列シフトレジスタの走査で選択できるようになっており、前記測定電極への被認証物の接触有無検出時及び測定を行わない待機時に前記各共通電極を電源及び接地に切り換えるスイッチ手段」が配設されていることを特徴とする個体認証センサ。

【請求項3】前記測定電極及び共通電極を含む基板表面を半導電性の薄膜で覆った請求項1又は2に記載の個体認証センサ。

【請求項4】前記測定電極からの出力電流を電圧に変換するI-V変換部が設けられている請求項1又は2に記載の個体認証センサ。

【請求項5】前記各測定電極にホトダイオードが接続されている請求項1又は2に記載の個体認証センサ。

【請求項6】前記共通電極に接続する電源が交流または 30 直流バイアスを含む交流電源である請求項1又は2に記載の個体認証センサ。

【請求項7】前記測定電極及び共通電極を含む基板表面 を絶縁性または半導電性の薄膜で覆った請求項6に記載 の個体認証センサ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、発汗を利用することなく、測定電極への指等の皮膚の接触の程度により生じる電気特性の変化を利用した個体認証センサ、特に被認証個体のレプリカを用いて本人になりすますようにした誤認証を防止する個体認証センサに関する。

[0002]

【従来の技術】従来の方式としては、1列に並べられた電極パッドを1次元に配置し、隣り合う電極パッドの間で入力部と出力部を形成し、1次元方向に順次読み取って合成することにより指紋の情報を検出するものがある(特開平8-235361号)。このセンサでは、表面に多孔質膜を配置し、水滴等をはじいて水蒸気を透過するようにしており、多孔質膜に指を押し付けると、指か50

ら放出された水分(発汗)が多孔質膜の孔を通過し、水 分が到達した電極パッド間では水分に存在するイオンに より電気抵抗値が低下するので、この信号変化を読み取 ることによって指紋を検出するようになっている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】上記従来の方式では、 隣り合う電極パッド間で順次読み取り合成して検出する ようにしているため、入力部及び出力部のそれぞれに隣 り合う電極パッドを選択するスイッチが必要となる。ま た、センサ表面上に多孔質膜を配置して、接触によって 電極パッドに到達した汗中のイオンによる電気抵抗の変 化を検出しているため、認証時には発汗していることが 必要である。

【0004】また、特開平7-168930号に示される表面形状センサでは、押圧力の強さに応じて抵抗値が変化する感圧シートで成る指の節の長さを検出する表面検出センサを設けるようにしている。このため、精巧に作成された指のレプリカを使用することにより、同一指と同一の検出信号を得ることができ、容易に他人になりすますことができるという大きな欠点があった。

【0005】本発明は上述のような事情よりなされたものであり、本発明の目的は、認証時に発汗の必要がなく、入力部の切り換えスイッチや感圧シートも不要で、精巧に偽造されたレプリカに対しても誤識別を確実に防止できるようにした個体認証センサを提供することにある。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明は、指紋等で認証 を採るような個体認証センサに関し、本発明の上記目的 は、半導体基板上に複数の測定電極を有し、前記測定電 極の周辺に第一の共通電極が設けられており、前記各測 定電極と検出回路とを選択的に接続するスイッチング素 子を行シフトレジスタ及び列シフトレジスタの走査で選 択できるようになっており、前記測定電極への被認証物 の接触有無検出測定時及び測定を行わない待機時に前記 共通電極を電源及び接地に切り換えるスイッチ手段を配 設することによって達成される。また、半導体基板上に 複数の測定電極を有し、前記測定電極の周辺に第一の共 通電極が設けられており、前記測定電極及び第一の共通 電極に隣接または離れた半導体基板上或いはその他の位 置に設けられた第二の共通電極を有し、前記各測定電極 に接続されたスイッチング素子を行シフトレジスタ及び 列シフトレジスタの走査で選択できるようになってお り、前記測定電極への被認証物の接触有無検出時及び測 定を行わない待機時に前記各共通電極を電源及び接地に 切り換えるスイッチ手段を配置することによって達成さ

【0007】共通電極を測定電極から離して配置することにより、例えば手の平といったような指以外の身体部分と指先との間で、生体の特徴があるか否かを検出する

ことができる。また、前記測定電極がマトリクス状に配置され、前記測定電極及び共通電極が表面に露出しているようにし、前記測定電極からの出力電流を電圧に変換する I – V変換部を設けることによって、より効果的に達成される。

【0008】また、美的効果や耐久性向上及び汚れ防止 の目的で、表面の測定電極および共通電極を含む基板表 面に半導電性の塗料等の薄膜を層設してもよい。このこ とにより、更に電気的導通を維持しながら、汚れや静電 気に対する耐性を向上し、外観を改善するといった効果 を達成できる。また、前記共通電極にスイッチを介して 接続する電源は、交流信号(直流に交流信号が重畳して いても、交流電源であってもよい。)を含んでいても良 く、電極表面に半導電性薄膜や絶縁薄膜を層設した場合 や指表面が皮脂等で汚れている場合でも、交流信号を検 出することで、より安定した信号測定ができる。特に交 流電源を使用することにより、直流分がカットされても その信号を検出することができる。この結果、電極を絶 縁物で覆うことができる。 I-V変換部は各測定電極毎 に設けても、各測定電極に共通する出力部に設けてもよ 11.

【0009】更に、前記各測定電極にホトダイオードを付加して明暗の変化を検出することにより、指が電極上に置かれたことを検出することができる。なお、このホトダイオードは、スイッチング素子に構造上寄生するホトダイオードを用いることができる。

[0010]

【発明の実施の形態】本発明は、I Cカードなどを用いて取り引きする場合に、指紋により本人の認証を行うための個体認証センサの電圧入力部の共通化を計り、認証時に発汗の必要がなく、感圧シートも必要とせず、指自体(体内)が低抵抗体の導体であることを利用した個体認証センサである。

【0011】図1は本発明の原理を模式的に示してお り、個体認証センサは複数の測定電極1及び電源2に接 続された共通電極3を有しており、認証時には指4を測 定電極1及び共通電極3に接触させる。測定電極1の各 間隔は指紋の山と谷の幅よりも狭くなっており、共通電 極3からは各測定電極1に対して共通に、スイッチング 手段を介することなく電源が供給されるようになってい る。そして、各測定電極1に接続されたスイッチ5で順 次切り換えると、電流が指4の体内を通じて流れるの で、そのときの電流を電流計6で検出することができ る。つまり、測定電極1が指4の指紋の山に接触する場 合には電流が流れ、測定電極1が指紋の谷に対向した場 合には電流が流れないので、スイッチ5の切り換えによ って各測定電極1の電流を検出することで指紋を特定す ることができる。また、図2は電圧の検出で指紋を特定 する例を示しており、動作原理は図1の場合と同様であ る。図3は複数の測定電極1毎にスイッチ5Aを接続

し、スイッチ5Aを順次切り換えることによって1つの 検出回路8で、指紋への接触の有無に対応した電流又は 電圧を同期して検出するようにしている。なお、検出回 路は各測定電極に設けることも可能であり、この場合で も、半導体製造プロセスにおける工程は変わらず、製造 コストが上昇することもない。

【0012】本発明においては、測定電極を絶縁薄膜で 覆うことも考慮に入れ、図1に示した電流による検出原 理を基に実施例の説明を行うこととする。

【0013】図4は、本発明の個体認証センサの具体的 なパターン構成例を模式的に示している。即ち、半導体 の矩形状センサ基板10の表面上には、認証時に指と接 触させるための正方形状の測定電極11がマトリクス状 に複数個配置され、電源供給用及び、人体に蓄積された 電荷放電用の共通電極13が、各測定電極11を囲繞す るように配置されている。各測定電極11はスイッチン グ素子12及び接続線14及び行スイッチングトランジ スタ22を介してI-V変換回路23に接続され、スイ ッチング素子12のON/OFFは接続線15を介して 列シフトレジスタ21で制御されている。また、列シフ トレジスタ21と共通電極13の端部との間には別の共 通電極16が静電保護のために配置されており、共通電 極13はスイッチ30を介して測定(電源供給)と待機 (接地) とを適宜切り換えるようになっており、共通電 極16はスイッチ31を介して測定(電源供給)と待機 (接地)とを切り換えるようになっている。測定電極1 1の選択は、行シフトレジスタ20及び列シフトレジス タ21を介してマトリクスの位置指定で行われ、接続線 14及び行スイッチングトランジスタ22を介して出力 される測定電極11からの電流は、I-V変換回路23 を経て電圧として出力される。行シフトレジスタ20及 び列シフトレジスタ21の動作、スイッチ30及び31 の切り換え等はCPU等(図示せず)で制御されるよう になっている。

【0014】測定電極11の材料としては、直流電流を 使用する場合には、測定対象エリアが電気回路的にクロ ズであるかオープンであるかを検出できれば良いの で、絶縁物以外のどのような材料でも良く、電極の形成 方法に制限はない。測定電極11の一例としてはAu薄 膜、Cu薄膜、Niメッキ薄膜、Pt薄膜等が良い。ま た、測定電極11は剥離や摩滅、腐食等が生じにくい電 極や電極構造を用いることが望ましく、この目的のため に、スルーホールにタングステン電極等を埋め込んだ構 造としてもよい。センサ基板10の材料としては、Si 基板やSOI (Silicon On Insulat or) 等の半導体を用いたり、ガラス基板上にTFT (Thin Film Transistor) 等を形 成してもよい。更に測定電極11の間隔は数十µm程度 で、指紋のピッチ(大人で約400~600 µm)より も十分細かいピッチとなっている。電極表面に層設する

4

半導電性薄膜の材料は、樹脂またはゴム材料にカーボンブラックを分散して体積導電化を図った分散系導電材料を使用する。電極表面に層設する絶縁薄膜の材料は、半導体製造プロセスで一般的に使用される石英ガラス(SiO2)やシリコン窒化膜(Si3N4)の他、サファイヤガラスをスパッタリングして形成した薄膜や、ポリテトラフルオロエチレン等の高分子絶縁材料等も使用可能である。

【0015】図5はスイッチング素子12をPMOSトランジスタで構成した場合の半導体構造例を示しており、このFETは図示するように、n型半導体基板であるセンサ基板10とp型拡散層で成る2個の寄生ホトダイオードを具備していることになる。両者は、測定電極11で電気的導通状態を制御するゲート部を介して接続されている。ドレイン側の寄生ホトダイオードは、接続線14及びスイッチング用FET22を介してI-V変換回路23に接続され、他方の寄生ホトダイオードは測定電極11に接続されている。なお、このn型基板10とp型拡散層は、分離のために逆バイアスが印加されている。また、ここでは寄生ホトダイオードを用いた例をったが、寄生ホトダイオードの効果を十分小さくし、別途適切な大きさのホトダイオードを形成して接続することも可能である。

【0016】図6及び図7は光信号受光時、つまり指がセンサ表面に接触し、共通電極に電源を接続するまでの個体認証センサの等価回路を示しており、行シフトレジスタ20を走査して順次ホトダイオード12aからの光電流を測定するか、或いは行シフトレジスタ20の入力を論理Hに固定して、行シフトレジスタ20の出力を全て論理Hにして全ての測定電極11についての光電流を検出し、光電流の低下を検出することにより、指がセンサ表面に置かれたことを判断する。その後、列シフトレジスタ21を走査して順次ホトダイオード12bからの光電流を測定することにより、共通電極を電源に接続して測定する際のオフセット電流分が測定でき、また同時に光学的指紋像を得ることができる。図7は、図6のホトダイオード部を詳細に示している。

【0017】図8は、図6及び図7で説明した指紋検出システムとしての機能プロックを示しており、測定電極11と共通電極13との間には高抵抗の皮膚抵抗が存在40するため、スイッチ30を電源に接続して指を測定電極11に接触すると、共通電極13から測定電極11に向かって電流が流れる。図12に詳細回路を示すが、測定電極11への電流は入力保護回路40及びアナログスイッチ41を経て、行シフトレジスタ20、列シフトレジスタ21、スイッチング用FET22及びその制御部から成る読出回路42に入力され、その後にI-V変換回路23で電圧信号に変換される。電圧信号は指紋照合ユニット51を経てホストコンピュータ50に与えられて処理される。ここで、I-V変換回路23は、図13及50

び図14に示す様に各測定電極において、入力保護回路 40とアナログスイッチ41との間に設置してもよい。 そして、この I - V変換回路部を個々の測定電極11毎 に基板10に設けることは、今日の半導体製造技術からして容易なことである。

【0018】入力保護回路40は図12に示すように、ダイオード、抵抗及びコンデンサで成る回路構成となっており、スイッチング部は図5ではP-MOS FETの例を示したが、図9に示すようなP-MOS FET41A及びN-MOS FET41Bで成るコンプリメンタリな回路構成のアナログスイッチを用いて、制御信号SGの論理信号の入力によってオンオフしてもよい。また、アナログスイッチ41の寄生スイッチング素子は図10に示すように、各スイッチ素子の入出力部にそれぞれホトダイオードが接続された構成となっており、I-V変換回路23は図11のような演算増幅器を用いた構成となっている。

【0019】認証のために、指が測定電極11に接触す るまでの待機状態においてはスイッチ30及び31は接 地されており、アナログスイッチ41のソース及びドレ イン部のpn接合は寄生スイッチング素子として光信号 を出力する。その状態を図示すると図12の矢印のよう になり、P-MOS FETとN-MOS FETの拡 散層の面積比を大きくとると、面積が大きい方の光電流 が支配的となり、光センサとして機能する。即ち、図1 2のアナログスイッチ41の下段のダイオードは、N-MOS FETのソース及びドレインから成る寄生ホト ダイオードを示しており、上段のダイオードはP-MO S FETのソース及びドレイン部から成る寄生ダイオ ードを示しており、矢印は光電流の流れる向きを示して いる。ただし、図12では、読出回路は省略してある。 図13は、上述した如くI-V変換回路の部分を測定電 極の近傍に設け、電圧信号に変換された信号を後段に送 る様にしたものを示す半導体構造図を示すものである。 また、図14は、I-V変換回路の部分を測定電極の近 傍に設けた場合の機能を示すブロック図であり、アナロ グスイッチ41の前段にI-V変換回路が位置してお り、測定電極11毎に設けられている。

【0020】上述のような構成において、その指紋検出の動作を図15及び16のフローチャートを参照して説明する。

【0021】先ず共通電極13及び16をスイッチ30及び31を介して接地し(ステップS1)、センサ上に指を置く前の外部環境の光電流初期値 Σ Iphoを測定する(ステップS2)。その後、光電流量 Σ Iphを測定し(ステップS3)、光電流量 Σ Iphと光電流初期値 Σ Iphoとの比(Σ Iph/ Σ Ipho)がスレッショルドK及びLの間になっているか否か、つまり指がセンサに近接しているか否かを判定する(ステップS4)。図4の状態で行シフトレジスタ20を走査し、各

信号を読み取る。ここで初期値の測定では、共通電極1 3及び共通電極16が接地電位なので寄生ホトダイオー ドの光電流が出力され、各光電流の総和ΣIphoを計 算する。総和ΣΙρhοは、広い面積を持った1個のホ トダイオード出力と等価である。測定時の光電流量 Σ I phの測定についても同様である。また、指が近接して いるか否かを判定している間、共通電極13及び共通電 極16を接地電位にしておき、指に帯電した電荷を共通 電極13及び共通電極16より放電させることにより、 静電破壊からセンサを保護する。指がセンサ上に置かれ ると、指により外部光が遮蔽されて光電流量が減少する ことを利用して、指の接触の有無及び適切な位置に指が 置かれたことを確認する。つまり、スレッショルドKよ りも小さいことを、K>ΣIph/ΣIphoで確認す る。また、指は光をある程度透過するので、外部光が指 により完全に遮蔽されることもない。つまり、ΣIph /ΣIpho>Lを確認する。

【0022】上記ステップS4で上記比ΣIph/ΣI phoがスレッショルドK及びLの間になっている場合 には、指がセンサ上に固定されたことが確認されたこと になるので、行シフトレジスタ20及び列シフトレジス 夕21を走査して各測定電極11の光電流Iphi(オ フセット分)を測定し(ステップS5)、スイッチ30 で共通電極13を測定電位にすると共に、スイッチ31 で共通電極16をフローテイングにする (ステップS 6)。そして、指紋電流 I f 1 i を各測定電極 1 1 毎に 測定し(ステップS7)、オフセット電流をキャンセル するために各信号電流Sli(=Ifli-Iphi) を計算する(ステップS8)。指紋電流Ifliの測定 は、各測定電極11に全く同じ条件で周囲近傍の共通電 極13から電流を供給し、行シフトレジスタ20及び列 シフトレジスタ21を走査して各センサ選択時の電流量 If1iを測定する。電流If1iには、測定電極11 と接触する指紋稜線部を通って共通電極13から流入す る電流とオフセット分の光信号が含まれる。そこで各信 号電流Sliを計算し、指紋稜線部を通って共通電極l 3から測定電極11に流入する電流量を各センサ毎に求 める。上記各信号電流Sli (= Ifli-Iphi) がスレッショルドHよりも小さいか否かを判定し(ステ ップS10)、スレッショルドH以上の場合は低抵抗の ために測定エラーとし(ステップS11)、スレッショ ルドHより小さい場合には、指紋照合ユニット41にお いて指紋電流で指紋照合し(ステップS12)、その結 果をホストコンピュータ40へ伝送する(ステップS1 3)。測定電極11と指との間の抵抗は皮膚の状態によ って大きく変動するが、数MΩ程度になるなど概して高 抵抗であるので、各信号電流S1iがスレッショルドH よりも小さいかを判定する。金属製の偽造指紋又は指紋 のレプリカの表面に蒸着などで金属薄膜を堆積したよう な偽造指紋では大きな電流が流れるので、偽造と判断し てエラー処理を行う。また、指紋照合ユニット41における指紋照合は、指紋稜線部を通って共通電極13から測定電極11に流入する正味の電流量を用いて得られた指紋画像で行う。例えば、同一行の信号の山谷を検出して2値化し、予め登録されている指紋パターンとのパターンマッチングで指紋照合を行う。

【0023】その後、共通電極13をスイッチ30でフ ローテイングにすると共に、共通電極16をスイッチ3 1で測定電位にし(ステップS14)、各指紋電流 I f 2 i を測定する (ステップS 1 5)。この場合、共通電 極16から電流を供給し、行シフトレジスタ20及び列 シフトレジスタ21を走査して、各センサ選択時の電流 型 I f 2 i を測定する。電流 I f 2 i には、測定電極 1 1と接触する指紋稜線部を通って共通電極13から流入 する電流とオフセット分の光信号が含まれているので、 各信号電流S2iを計算し、指紋稜線部を通って共通電 極13から測定電極11に流入する電流量を各センサ毎 に求める。各信号電流S2i (= If2i-Iphi) を計算し(ステップS16)、上記各信号電流S2i (= If2i-Iphi) がスレッショルドHよりも小 さいか否かを判定し(ステップS20)、スレッショル ドH以上の場合は低抵抗のために測定エラーとし(ステ ップS21)、スレッショルドHより小さい場合には、 比S2i/S1iがスレッショルドQ及びRの間に入っ ているか否かを判定する(ステップS22)。スレッシ ョルドQ及びRの間に入っていない場合には測定エラー とし(ステップS23)、スレッショルドQ及びRの間 に入っている場合には指紋電流で指紋照合し(ステップ S24)、その結果をホストコンピュータ40へ伝送す る(ステップS25)。即ち、共通電極16は各測定電 極11の近傍にはなく、各測定電極11との距離も一様 ではない。人体の場合、測定電極11と皮膚との間の抵 抗は比較的高抵抗であるが、人体内部は端から端までで も500Ω程度と低抵抗であるため、共通電極16の位 置は測定結果に殆ど影響しない。従って、本物の指の場 合には、共通電極13を電源とした場合の各信号電流S 1 i は、共通電極16を電源とした場合の各信号電流S 2 i と殆ど等しくなる。そこで、上記判断式で、例えば 内部まで一様な抵抗材料を用いた指の偽造品等を識別す

【0024】尚、上述では指紋について説明したが、足紋等についても全く同様に適用できる。上記の実施例では第2の共通電極16は測定電極の近傍にあるものを説明したが、例えば、共通電極が左の手で、金属部分を押さえた状態で右の人指し指を測定電極のある部分を押さえるといったことも可能である。これは、体内での抵抗値が極めて低いということから達成される。

【0025】また、図17の回路図は共通電極13、16に交流電源を供給、或いは直流電源に交流成分を重畳 させる場合のものである。共通電極13、16に供給す

,

る電源は、入力保護回路等の回路用電源A及びBの電圧 範囲内で変動させる必要がある。なお、図は省略してあ るが、例えば、交流成分は後段で、整流回路及びピーク ホールド回路により波高値を測定するといった信号処理 をするとよい。

【0026】交流電源を使用する場合は、検出電流の振 幅の大きが測定系のインピーダンスに反比例するので、 電流の波髙値を検出することにより指紋の接触の有無を 確認できる。接触時には波高値が高く、非接触時には低 くなる。これらは、汎用の技術を使用することにより達 10 成されるので詳細説明は省略する。

【0027】さらに、測定電極11を絶縁物でできた薄 膜で覆う場合には、検出部の電源には直流の使用ができ ないので、検出回路は図17で示される様な交流信号に 対応したものを設ける必要がある。これにより、測定電 極面が汚れても異常なく検出測定ができると共に、セン サ面の耐久性を増大させることができる。

[0028]

【発明の効果】以上説明したように、本発明の個体認証 センサによれば、認証時に発汗の必要もなく、入力部の 20 切り替えスイッチや感圧シートも不要で、構造がシンプ ルで製造コストも安く、精巧に偽造されたレプリカに対 しても誤識別を確実に防止できる。また、被検出部と測 定電極との間にシートを挟むこともないので高い分解能 が得られ、機械的に弱い部分がないために耐久性が高い といった利点がある。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の原理を電流検出で模式的に示す図であ

【図2】本発明の原理を電圧検出で模式的に示す図であ 30

【図3】本発明の指紋検出の様子を模式的に示す図であ

【図4】本発明の個体認証センサの具体的なパターン構 成例を模式的に示す回路結線図である。

【図5】本発明の個体認証センサのスイッチング素子部

分の半導体構造例を示す図である。

【図6】本発明の個体認証センサの光信号受光時の等価 回路を示す図である。

【図7】図6におけるホトダイオードの詳細構成を示す 図である。

【図8】本発明による指紋検出システムの機能を示すブ ロック図である。

【図9】アナログスイッチの一例を示す回路図である。

【図10】アナログスイッチの寄生スイッチング素子を 示す回路図である。

【図11】I-V変換回路の一例を示す回路図である。

【図12】入力部の回路図であり、アナログスイッチ4 1の矢印は 寄生ホトダイオードの光電流の流れる向き を示している。

【図13】測定電極の近傍にI-V変換回路を設けた場 合の半導体構成例を示した図である。

【図14】本発明による測定電極の近傍にI-V変換回 路を設けた場合の指紋検出システムの機能を示すブロッ ク図である。

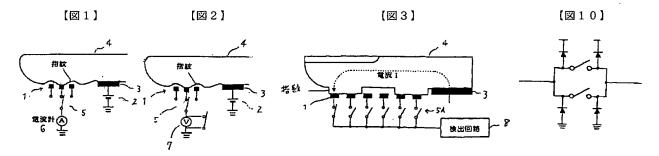
【図15】本発明の動作例を示すフローチャートの一部 である。

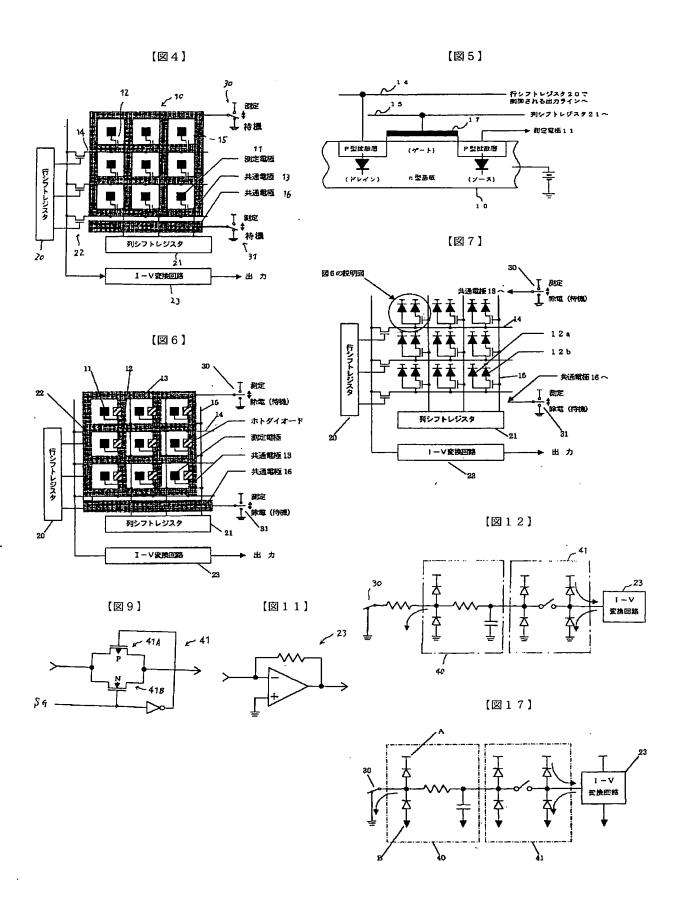
【図16】本発明の動作例を示すフローチャートの一部 である。

【図17】本発明による測定電極に印加する電源を交流 電源とした場合の回路図である。

【符号の説明】

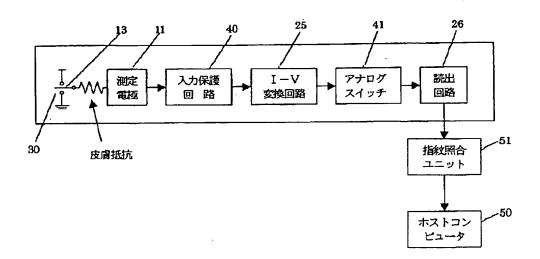
	1, 11	測定電極
	2	電源
	3.13.16	共通電極
1	4	指
	5	スイッチ
	6	電流計
	7	電圧計
	1 2	スイッチング素子
	2 0	行シフトレジスタ
	2 1	列シフトレジスタ

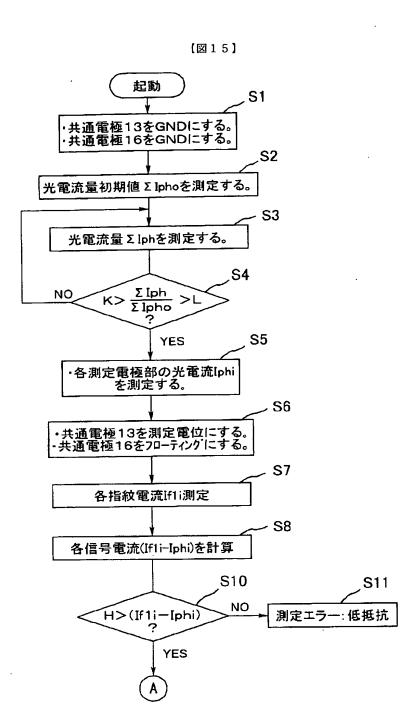




•

【図14】





【図16】 **S12 S13** 結果はホストコンピュータへ 照合 I:指紋電流で指紋照合 **S14** ・共通電極13をフローティングにする。・共通電極16を測定電位にする。 S15 各指紋電流If2i測定 **S16** 各信号電流(If2i-Iphi)を計算 S21 S20 NO H>(If2i-Iphi) 測定エラー: 低抵抗 YES **S22 S23** NO Q>-測定エラー: S1i **S24** S25 YES 照合 II: 指紋電流で指紋照合 結果はホストコンピュータへ

フロントページの続き

.

(72)発明者 ▲吉▼川 大介 兵庫県姫路市下手野一丁目3番1号 グロ ーリー工業株式会社内

終了

(72)発明者 長谷川 忠昭 兵庫県姫路市御国野町国分寺67番地 グロ ーリー機器株式会社内